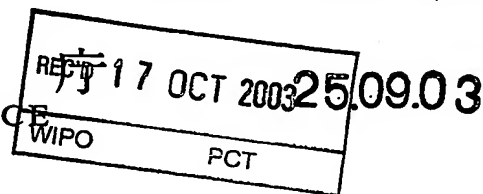


PCT/JP 03/12226

日本国特許

JAPAN PATENT OFFICE



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日
Date of Application: 2003年 3月26日

出願番号
Application Number: 特願2003-085426
[ST. 10/C]: [JP2003-085426]

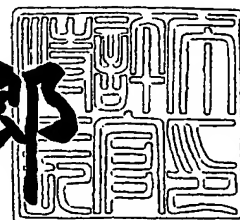
出願人
Applicant(s): 旭電化工業株式会社

**PRIORITY
DOCUMENT**
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2003年 7月10日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

太田信一郎



【書類名】 特許願

【整理番号】 ADP0112

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 C08J 3/28

【発明者】

【住所又は居所】 東京都荒川区東尾久七丁目2番35号 旭電化工業株式会社内

【氏名】 中屋敷 哲千

【発明者】

【住所又は居所】 東京都荒川区東尾久七丁目2番35号 旭電化工業株式会社内

【氏名】 立川 裕之

【特許出願人】

【識別番号】 000000387

【氏名又は名称】 旭電化工業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100096714

【弁理士】

【氏名又は名称】 本多 一郎

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 026516

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9400509

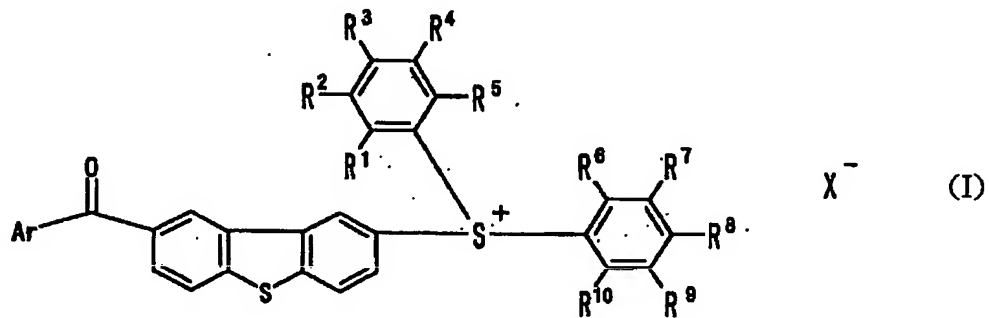
【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 新規な芳香族スルホニウム塩化合物、これからなる光酸発生剤およびこれを含む光重合性組成物、光学的立体造形用樹脂組成物並びに光学的立体造形法

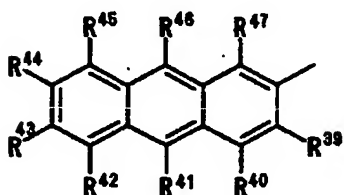
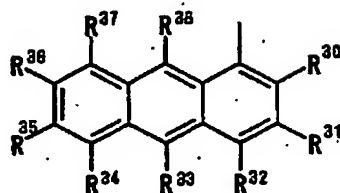
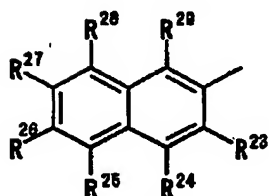
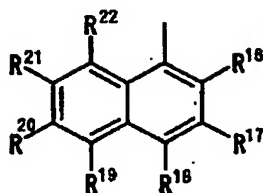
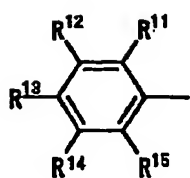
【特許請求の範囲】

【請求項 1】 下記一般式 (I)、

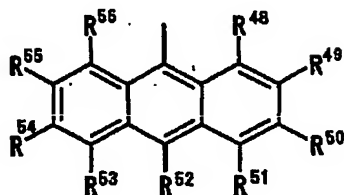


(式中、R¹～R¹⁰は、水素原子、ハロゲン原子、ニトロ基、水酸基、アルキル基、アルコキシ基または炭素原子数 1～8 のフルオロアルキル基であり、同一であっても異なってもよく、

Arは、



または



であり、

R¹¹～R⁵⁶は、水素原子、ハロゲン原子、水酸基、アルキル基またはアルコキシ基であり同一であっても異なってもよく、

Xは1価のアニオンになりうる原子団である)で表されることを特徴とする芳香族スルホニウム塩化合物。

【請求項2】 一般式(I)中のArがフェニル基である請求項1に記載の芳香族スルホニウム塩化合物。

【請求項3】 化合物のX⁻で表されるアニオン部が、SbF₆⁻、PF₆⁻、AsF₆⁻、BF₄⁻、SbCl₆⁻、ClO₄⁻、CF₃SO₃⁻、CH₃SO₃⁻、FSO₃⁻、F₂PO₂⁻、p-トルエンスルフォネート、カンファースルフォネート、ノナフロロブタンスルフォネート、ヘキサデカフロロオクタンスルフォネート、テトラアリールボレートからなる群から選ばれるいずれかの基である請求項1又は請求項2に記載の芳香族スルホニウム塩化合物。

【請求項4】 請求項1ないし3のうちいずれか一項に記載の芳香族スルホニウム塩化合物からなることを特徴とする光酸発生剤。

【請求項5】 必須の構成成分として、(1)カチオン重合性有機物質と、

(2) エネルギー線感受性カチオン重合開始剤として請求項 4 に記載の光酸発生剤とを含有することを特徴とする光重合性組成物。

【請求項 6】 必須の構成成分として、更に (3) ラジカル重合性有機物質と、(4) エネルギー線感受性ラジカル重合開始剤とを含有する請求項 5 に記載の光重合性組成物。

【請求項 7】 前記 (1) カチオン重合性有機物質の少なくとも 1 種が、1 分子中に 1 個以上のエポキシ基を有する有機化合物である請求項 5 又は請求項 6 に記載の光重合性組成物。

【請求項 8】 請求項 5～7 のうちいずれか一項に記載の光重合性組成物からなることを特徴とする光学的立体造形用樹脂組成物。

【請求項 9】 前記 (1) カチオン重合性有機物質のうち 30 重量%以上が分子中にシクロヘキセンオキシド構造を有する化合物である請求項 8 に記載の光学的立体造形用樹脂組成物。

【請求項 10】 前記 (1) カチオン重合性有機物質のうち 30 重量%以上が分子中にオキセタン構造を有する化合物である請求項 8 に記載の光学的立体造形用樹脂組成物。

【請求項 11】 前記 (3) ラジカル重合性有機物質のうち 50 重量%以上が分子中に (メタ) アクリル基を有する化合物であることを特徴とする請求項 8～10 のうちいずれか一項に記載の光学的立体造形用樹脂組成物。

【請求項 12】 エネルギー線硬化性樹脂組成物の任意の表面にエネルギー線を照射し、該樹脂組成物のエネルギー線照射表面を硬化させて所望の厚さの硬化層を形成し、該硬化層上に前述のエネルギー線硬化性樹脂組成物をさらに供給して、これを同様に硬化させ前述の硬化層と連続した硬化物を得る積層操作を行い、この操作を繰り返すことによって三次元の立体物を得る光学的立体造形法において、上記エネルギー線硬化性樹脂組成物が請求項 8～11 のうちいずれか一項に記載の光学的立体造形用樹脂組成物であることを特徴とする光学的立体造形法。

【請求項 13】 照射するエネルギー線が、紫外光である請求項 12 記載の光学的立体造形法。

【請求項 14】 250～400 nm の波長の波長間の光の総合計エネルギー量に対して、345 nm～360 nm の波長間の合計エネルギー量が 70 % 以上である光を照射する請求項 13 記載の光学的立体造形法。

【請求項 15】 照射するエネルギー線がレーザー光である請求項 12～14 のうちいずれか一項に記載の光学的立体造形法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、新規な芳香族スルホニウム塩化合物、これからなる光酸発生剤およびこの光酸発生剤を含む光重合性組成物、光学的立体造形用樹脂組成物並びに光学的立体造形法に関する。

【0002】

【従来の技術】

光酸発生剤は、光照射を受けると酸を発生する物質で、カチオン重合用光開始剤などとして有用であり、光造形用樹脂組成物や塗料、コーティング、接着剤等の光重合性組成物などに使用されている。このような光酸発生剤を開示した先行技術の例として特許文献 1 がある。

【0003】

特許文献 1 には、光酸発生剤として有用な芳香族スルホニウム塩化合物が記載され、この光酸発生剤を使用したエポキシ樹脂のカチオン重合用光開始剤、これを使用した光重合性組成物が記載され、更にこれらの組成物を使用した光造形用樹脂組成物と光学的立体造形法について記載されている。

【0004】

【特許文献 1】

特開 2000-186071 号公報（特許請求の範囲等）

【0005】

【発明が解決しようとする課題】

特許文献 1 に記載の光酸発生剤は、それまでのものと比べれば確かに高感度であって、迅速硬化できる光重合性組成物を提供したり、酸素による硬化阻害がお

こらず精度のよい立体造形物を得ることができるが、実用的見地から、より感度の高いものがなお望まれていた。

【0006】

そこで本発明の目的は、光源からの光を効率的に吸収し、迅速で良質な硬化物を与える良好な光重合開始剤として有用な新規化合物、これからなる光酸発生剤およびこれを含有する光重合性組成物を提供することにある。

【0007】

また、本発明の他の目的は、上述の従来技術の欠点を解消し、酸素による硬化障害が起こらず、硬化時の精度が良く、容易に所望の寸法の造形物を得ることができ、しかも照射エネルギーに対して高感度で、硬化深度が十分である、光学的立体造形用樹脂組成物およびこれを用いた光学的立体造形方法を提供することにある。

【0008】

【課題を解決するための手段】

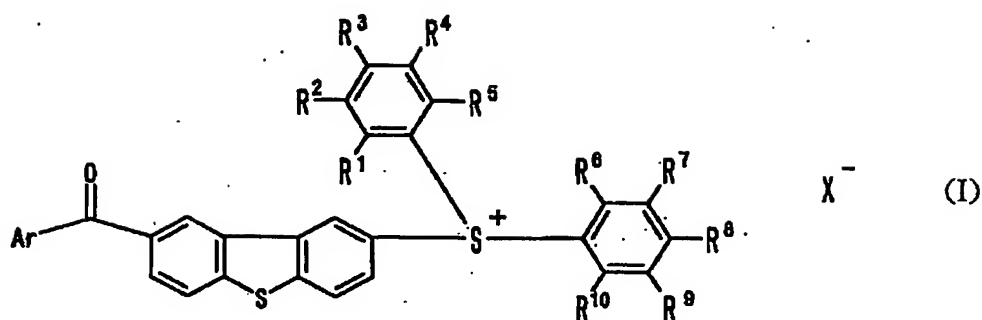
本発明者は上記課題を解決するべく鋭意検討した結果、下記一般式 (I) で表される新規な芳香族スルホニウム塩化合物を合成するにいたり、またこの化合物が効率良く長波長部の光を吸収し活性化されることを見出し、さらにこれを含有する光重合性組成物は迅速に硬化し良質な硬化物物性を与え、またこれを含有するフォトレジストが高感度、高解像度を有することを見出し、本発明を完成するに至った。

【0009】

また、カチオン重合性有機物質と、エネルギー線感受性カチオン重合開始剤として下記一般式 (I) の芳香族スルホニウム塩化合物を含有する光学的立体造形用樹脂組成物を使用し、照射エネルギーとして特定条件の光を使用して光造形を行ったところ、酸素による硬化障害が起こらず、硬化時の精度が良く容易に所望の寸法の造形物を得ることができ、しかも照射エネルギーに対して高感度であることを見出し、本発明を完成するに至った。

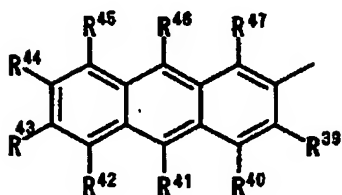
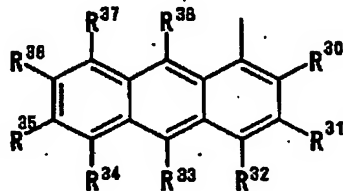
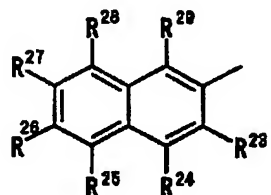
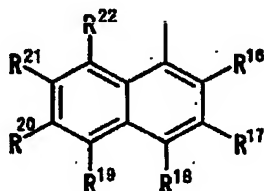
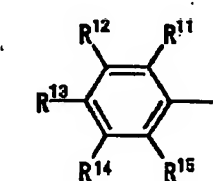
【0010】

すなわち、本発明の芳香族スルホニウム化合物は、下記一般式 (I) 、

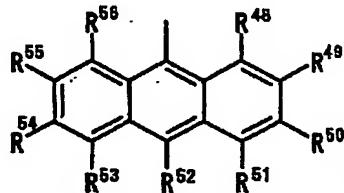


(式中、 $R^1 \sim R^{10}$ は、水素原子、ハロゲン原子、ニトロ基、水酸基、アルキル基、アルコキシ基または炭素原子数1～8のフルオロアルキル基であり、同一であっても異なってもよく、

Arは、



または



であり、

$R^{11} \sim R^{56}$ は、水素原子、ハロゲン原子、水酸基、アルキル基またはアルコキシ基であり同一であっても異なってもよく、
Xは1価のアニオンになりうる原子団である) で表されることを特徴とするものである。

【0011】

また、本発明は、前記芳香族スルホニウム塩化合物からなることを特徴とする光酸発生剤である。

【0012】

更に、本発明は、(1) カチオン重合性有機物質と、(2) エネルギー線感受性カチオン重合開始剤として前記酸発生剤とを含有することを特徴とする光重合性組成物、または該光重合性組成物に更に(3) ラジカル重合性有機物質と(4) エネルギー線感受性ラジカル重合開始剤とを含有する光重合組成物である。

【0013】

この光重合性組成物においては、任意の成分として、(5) 1分子中に2個以上の水酸基を有する有機化合物、(6) 熱可塑性高分子化合物などを含めることができる。

【0014】

更にまた、本発明は、前記光重合性組成物からなる光学的立体造形用樹脂組成物である。

【0015】

更にまた、本発明は、上記光学的立体造形用樹脂組成物の任意の表面に、250～400nmの波長間の光の総合計エネルギー量に対して345～360nmの波長間の光の合計エネルギー量が70%以上である光を照射し、該樹脂組成物の光照射表面を硬化させて所望の厚さの硬化層を形成し、該硬化層上に前述の光学的立体造形用樹脂組成物をさらに供給して、これを同様に硬化させ前述の硬化層と連続した硬化物を得る積層操作を行ない、この操作を繰り返すことによって三次元の立体物を得ることを特徴とする光学的立体造形法である。

【0016】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態につき具体的に説明する。

前記一般式(I)で表される化合物において、 $R^1 \sim R^{10}$ は、水素原子、ハロゲン原子、ニトロ基、水酸基、アルキル基、アルコキシ基または炭素原子数1～8のフルオロアルキル基であり、同一であっても異なってもよい。ハロゲン原子としては、例えば、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子が挙げら

れるが、エネルギー線感受性の点で、好ましくはフッ素原子がよい。アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、ターシャリブチル基、ペンチル基、イソペンチル基、ターシャリペンチル基、ネオペンチル基、ヘキシル基、イソヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、2-エチルヘキシル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル基、トリデシル基、イソトリデシル基、ミリスチル基、パルミチル基、ステアリル基等を挙げることができ、好ましくは炭素原子数1~4のアルキル基がよく、特にメチル基、エチル基がよい。アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロピルオキシ基、ブチルオキシ基、ペンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基、ヘプチルオキシ基、オクチルオキシ基、ノニルオキシ基、デシルオキシ基、ウンデシルオキシ基、ドデシルオキシ基、トリデシルオキシ基、ミリスチルオキシ基、パルミチルオキシ基、ステアリルオキシ基等を挙げることができ、好ましくは炭素原子数1~4のアルコキシ基がよく、特にメトキシ基、エトキシ基がよい。フルオロアルキル基としては、フルオロメチル基、ジフルオロメチル基、トリフルオロメチル基、ジフルオロエチル基、パーフルオロエチル基等を挙げることができ、特にトリフルオロメチル基がよい。

【0017】

これらの基は同一であっても異なってもよいが、好ましくは、 $R^1 \sim R^{10}$ の全てが水素原子であるか、或いは $R^1 \sim R^5$ のうちいずれか1又は2個（好ましくは1個）が水素原子以外であり他は全て水素原子であって、 $R^6 \sim R^{10}$ のうちいずれか1又は2個（好ましくは1個）が水素原子以外であり他は全て水素原子であることがよく、より好ましくは $R^1 \sim R^{10}$ の全てが水素原子であるか、或いは $R^1 \sim R^5$ のうちいずれか1個がメチル基、フッ素、ニトロ基から選ばれる基であり他は全て水素原子であって、 $R^6 \sim R^{10}$ のうちいずれか1個がメチル基、フッ素、ニトロ基から選ばれる基であり他は全て水素原子であることがよい。

【0018】

前記一般式(I)の A_r 中の $R^{11} \sim R^{56}$ は、水素原子、ハロゲン原子、水酸基、アルキル基またはアルコキシ基であり、同一であっても異なってもよい。ハロゲン原子としては例えば、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子が

挙げられる。アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、ターシャリブチル基、ペンチル基、イソペンチル基、ターシャリペンチル基、ネオペンチル基、ヘキシル基、イソヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、2-エチルヘキシル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル基、トリデシル基、イソトリデシル基、ミリスチル基、パルミチル基、ステアリル基等を挙げることができ、アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロピルオキシ基、ブチルオキシ基、ペンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基、ヘプチルオキシ基、オクチルオキシ基、ノニルオキシ基、デシルオキシ基、ウンデシルオキシ基、ドデシルオキシ基、トリデシルオキシ基、ミリスチルオキシ基、パルミチルオキシ基、ステアリルオキシ基等を挙げることができる。

【0019】

これらの基は同一であっても異なってもよいが、好ましくは、全て水素原子であることがよい。また、Ar基として最も好ましいのはフェニル基である。

【0020】

前記一般式(I)においてXは1価のアニオンになりうる原子団である。これらの中でもX⁻としては、SbF₆⁻、PF₆⁻、AsF₆⁻、BF₄⁻、SbCl₆⁻、ClO₄⁻、CF₃SO₃⁻、CH₃SO₃⁻、FSO₃⁻、F₂PO₂⁻、p-トルエンスルフォネート、カンファースルフォネート、ノナフロロブタンスルフォネート、ヘキサデカフロロオクタンスルフォネート、テトラアリアルボレート等が合成上特に好ましい。

【0021】

テトラアリアルボレートの具体例としては、例えば、テトラフェニルボレート、及びこれのフェニル基上の少なくとも1つの水素原子がアルキル基、ハロゲン原子、ハロゲン化アルキル基、ヒドロキシアルキル基、アルコキシル基、フェニル基、アルコキシカルボニル基で置換された化合物等を挙げることができ、好ましいものとしてはテトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、テトラキス(4-フルオロフェニル)ボレート、テトラフェニルボレート等を挙げることができる。

【0022】

本発明における前記一般式 (I) で表されるスルホニウム塩として好ましいものは、

4- (2-クロロ-4-ベンゾイルフェニルチオ) フェニルジフェニルスルホニウムヘキサフロロアンチモネート

4- (2-クロロ-4-ベンゾイルフェニルチオ) フェニルビス (4-フロロフェニル) スルホニウムヘキサフロロアンチモネート

4- (2-クロロ-4-ベンゾイルフェニルチオ) フェニルビス (4-クロロフェニル) スルホニウムヘキサフロロアンチモネート

4- (2-クロロ-4-ベンゾイルフェニルチオ) フェニルビス (4-メチルフェニル) スルホニウムヘキサフロロアンチモネート

4- (2-クロロ-4-ベンゾイルフェニルチオ) フェニルビス (4- (β -ヒドロキシエトキシ) フェニル) スルホニウムヘキサフロロアンチモネート

4- (2-メチル-4-ベンゾイルフェニルチオ) フェニルビス (4-フロロフェニル) スルホニウムヘキサフロロアンチモネート

4- (3-メチル-4-ベンゾイルフェニルチオ) フェニルビス (4-フロロフェニル) スルホニウムヘキサフロロアンチモネート

4- (2-フロロ-4-ベンゾイルフェニルチオ) フェニルビス (4-フロロフェニル) スルホニウムヘキサフロロアンチモネート

4- (2-メチル-4-ベンゾイルフェニルチオ) フェニルビス (4-フロロフェニル) スルホニウムヘキサフロロアンチモネート

4- (2, 3, 5, 6-テトラメチル-4-ベンゾイルフェニルチオ) フェニルビス (4-フロロフェニル) スルホニウムヘキサフロロアンチモネート

4- (2, 6-ジクロロ-4-ベンゾイルフェニルチオ) フェニルビス (4-フロロフェニル) スルホニウムヘキサフロロアンチモネート

4- (2, 6-ジメチル-4-ベンゾイルフェニルチオ) フェニルビス (4-フロロフェニル) スルホニウムヘキサフロロアンチモネート

4- (2, 3-ジメチル-4-ベンゾイルフェニルチオ) フェニルビス (4-フロロフェニル) スルホニウムヘキサフロロアンチモネート

- 4- (2-メチル-4-ベンゾイルフェニルチオ) フェニルビス (4-クロロフェニル) スルホニウムヘキサフロロアンチモネート
- 4- (3-メチル-4-ベンゾイルフェニルチオ) フェニルビス (4-クロロフェニル) スルホニウムヘキサフロロアンチモネート
- 4- (2-フロロ-4-ベンゾイルフェニルチオ) フェニルビス (4-クロロフェニル) スルホニウムヘキサフロロアンチモネート
- 4- (2-メチル-4-ベンゾイルフェニルチオ) フェニルビス (4-クロロフェニル) スルホニウムヘキサフロロアンチモネート
- 4- (2, 3, 5, 6-テトラメチル-4-ベンゾイルフェニルチオ) フェニルビス (4-クロロフェニル) スルホニウムヘキサフロロアンチモネート
- 4- (2, 6-ジクロロ-4-ベンゾイルフェニルチオ) フェニルビス (4-クロロフェニル) スルホニウムヘキサフロロアンチモネート
- 4- (2, 6-ジメチル-4-ベンゾイルフェニルチオ) フェニルビス (4-クロロフェニル) スルホニウムヘキサフロロアンチモネート
- 4- (2, 3-ジメチル-4-ベンゾイルフェニルチオ) フェニルビス (4-クロロフェニル) スルホニウムヘキサフロロアンチモネート
- 4- (2-クロロ-4-アセチルフェニルチオ) フェニルジフェニルスルホニウムヘキサフロロアンチモネート
- 4- (2-クロロ-4- (4-メチルベンゾイル) フェニルチオ) フェニルジフェニルスルホニウムヘキサフロロアンチモネート
- 4- (2-クロロ-4- (4-フロロベンゾイル) フェニルチオ) フェニルジフェニルスルホニウムヘキサフロロアンチモネート
- 4- (2-クロロ-4- (4-メトキシベンゾイル) フェニルチオ) フェニルジフェニルスルホニウムヘキサフロロアンチモネート

【0023】

- 4- (2-クロロ-4-ドデカノイルフェニルチオ) フェニルジフェニルスルホニウムヘキサフロロアンチモネート
- 4- (2-クロロ-4-アセチルフェニルチオ) フェニルビス (4-フロロフェニル) スルホニウムヘキサフロロアンチモネート

- 4- (2-クロロ-4- (4-メチルベンゾイル) フェニルチオ) フェニルビス
 (4-フロロフェニル) スルホニウムヘキサフロロアンチモネート
- 4- (2-クロロ-4- (4-フロロベンゾイル) フェニルチオ) フェニルビス
 (4-フロロフェニル) スルホニウムヘキサフロロアンチモネート
- 4- (2-クロロ-4- (4-メトキシベンゾイル) フェニルチオ) フェニルビ
 ス (4-フロロフェニル) スルホニウムヘキサフロロアンチモネート
- 4- (2-クロロ-4-ドデカノイルフェニルチオ) フェニルビス (4-フロロ
 フェニル) スルホニウムヘキサフロロアンチモネート
- 4- (2-クロロ-4-アセチルフェニルチオ) フェニルビス (4-クロロフェ
 ニル) スルホニウムヘキサフロロアンチモネート
- 4- (2-クロロ-4- (4-メチルベンゾイル) フェニルチオ) フェニルビス
 (4-クロロフェニル) スルホニウムヘキサフロロアンチモネート
- 4- (2-クロロ-4- (4-フロロベンゾイル) フェニルチオ) フェニルビス
 (4-クロロフェニル) スルホニウムヘキサフロロアンチモネート
- 4- (2-クロロ-4- (4-メトキシベンゾイル) フェニルチオ) フェニルビ
 ス (4-クロロフェニル) スルホニウムヘキサフロロアンチモネート
- 4- (2-クロロ-4-ドデカノイルフェニルチオ) フェニルビス (4-クロロ
 フェニル) スルホニウムヘキサフロロアンチモネート

【0024】

- 4- (2-クロロ-4-ベンゾイルフェニルチオ) フェニルジフェニルスルホニ
 ウムヘキサフロロホスフェート
- 4- (2-クロロ-4-ベンゾイルフェニルチオ) フェニルジフェニルスルホニ
 ウムテトラフロロボレート
- 4- (2-クロロ-4-ベンゾイルフェニルチオ) フェニルジフェニルスルホニ
 ウムパークロレート
- 4- (2-クロロ-4-ベンゾイルフェニルチオ) フェニルジフェニルスルホニ
 ウムトリフロロメタンスルホネート
- 4- (2-クロロ-4-ベンゾイルフェニルチオ) フェニルビス (4-フロロフ
 エニル) スルホニウムヘキサフロロホスフェート

4- (2-クロロ-4-ベンゾイルフェニルチオ) フェニルビス (4-フロロフェニル) スルホニウムテトラフロロボレート

4- (2-クロロ-4-ベンゾイルフェニルチオ) フェニルビス (4-フロロフェニル) スルホニウムパークロレート

4- (2-クロロ-4-ベンゾイルフェニルチオ) フェニルビス (4-フロロフェニル) スルホニウムトリフロロメタンスルホネート

4- (2-クロロ-4-ベンゾイルフェニルチオ) フェニルビス (4-フロロフェニル) スルホニウム p-トルエンスルフォネート

4- (2-クロロ-4-ベンゾイルフェニルチオ) フェニルビス (4-フロロフェニル) スルホニウムカンファースルフォネート

4- (2-クロロ-4-ベンゾイルフェニルチオ) フェニルビス (4-フロロフェニル) スルホニウムノナフロロブタンスルフォネート

4- (2-クロロ-4-ベンゾイルフェニルチオ) フェニルビス (4-クロロフェニル) スルホニウムヘキサフロロホスフエート

4- (2-クロロ-4-ベンゾイルフェニルチオ) フェニルビス (4-クロロフェニル) スルホニウムテトラフロロボレート

4- (2-クロロ-4-ベンゾイルフェニルチオ) フェニルビス (4-クロロフェニル) スルホニウムパークロレート

4- (2-クロロ-4-ベンゾイルフェニルチオ) フェニルビス (4-クロロフェニル) スルホニウムトリフロロメタンスルホネート

などが挙げられる。

【0025】

上記の化合物は、例えば、Ar をフェニル基とすると、ジベンゾチオフエンと塩化ベンゾイルの反応によってベンゾイルジベンゾチオフエンを得、例えば、硫酸中でこれに置換又は非置換のジフェニルスルホキシドを反応させた後、塩交換することにより得られる。

【0026】

本発明の光酸発生剤は、紫外線、電子線、X線、放射線、高周波などの活性エネルギー線の照射によりルイス酸を放出する特性を有し、カチオン重合性有機物

質に作用して重合を開始することができる。従って、本発明の光酸発生剤は、カチオン性光重合開始剤として有用である。

【0027】

また、本発明の光酸発生剤は、従来の芳香族スルホニウム塩と比較して、吸収波長領域が長波長部にシフトし、一般に使用される光源のなかでも、高圧水銀灯の最も強い発光波長である 365 nm の光を効率よく吸収する。その結果、本発明の芳香族スルホニウム塩化合物を配合したカチオン重合性組成物やフォトレジストは従来の芳香族スルホニウム塩化合物を配合したカチオン重合組成物やフォトレジストに比較してその感度が大幅に向上する。

【0028】

本発明の光重合性組成物の成分である (1) カチオン重合性有機物質とは、光照射により活性化したカチオン性重合開始剤により高分子化または、架橋反応を起こす化合物をいう。

【0029】

例えば、エポキシ化合物、オキセタン化合物、環状ラクトン化合物、環状アセタール化合物、環状チオエーテル化合物、スピロオルトエステル化合物、ビニル化合物などであり、これらの 1 種または 2 種以上使用することができる。中でも入手するのが容易であり、取り扱いに便利なエポキシ化合物が適している。該エポキシ化合物としては、芳香族エポキシ化合物、脂環族エポキシ化合物、脂肪族エポキシ化合物などが適している。

【0030】

前記脂環族エポキシ樹脂の具体例としては、少なくとも 1 個の脂環族環を有する多価アルコールのポリグリシジルエーテルまたはシクロヘキセンやシクロペンテン環含有化合物を酸化剤でエポキシ化することによって得られるシクロヘキセンオキサイドやシクロペンテンオキサイド含有化合物が挙げられる。たとえば、水素添加ビスフェノール A ジグリシジルエーテル、3, 4-エポキシシクロヘキシルメチル-3, 4-エポキシシクロヘキサンカルボキシレート、3, 4-エポキシ-1-メチルシクロヘキシル-3, 4-エポキシ-1-メチルシクロヘキサンカルボキシレート、6-メチル-3, 4-エポキシシクロヘキシルメチル-6

ーメチル-3, 4-エポキシシクロヘキサンカルボキシレート、3, 4-エポキシ-3-メチルシクロヘキシルメチル-3, 4-エポキシ-3-メチルシクロヘキサンカルボキシレート、3, 4-エポキシ-5-メチルシクロヘキシルメチル-3, 4-エポキシ-5-メチルシクロヘキサンカルボキシレート、2-(3, 4-エポキシシクロヘキシル-5, 5-スピロ-3, 4-エポキシ)シクロヘキサン-メタジオキサン、ビス(3, 4-エポキシシクロヘキシルメチル)アジペート、3, 4-エポキシ-6-メチルシクロヘキシルカルボキシレート、メチレンビス(3, 4-エポキシシクロヘキサン)、ジシクロペンタジエンジエポキサイド、エチレンビス(3, 4-エポキシシクロヘキサンカルボキシレート)、エポキシヘキサヒドロフタル酸ジオクチル、エポキシヘキサヒドロフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等が挙げられる。

【0031】

前記脂環族エポキシ樹脂として好適に使用できる市販品としては UVR-6100、UVR-6105、UVR-6110、UVR-6128、UVR-6200 (以上、ユニオンカーバイド社製)、セロキサイド2021、セロキサイド2021P、セロキサイド2081、セロキサイド2083、セロキサイド2085、セロキサイド2000、セロキサイド3000、サイクロマーA200、サイクロマーM100、サイクロマーM101、エポリードGT-301、エポリードGT-302、エポリード401、エポリード403、ETHB、エポリードHD300 (以上、ダイセル化学工業(株)製)、KRM-2110、KRM-2199 (以上、旭電化工業(株)製)などを挙げることができる。

【0032】

前記脂環族エポキシ樹脂の中でも、シクロヘキセンオキシド構造を有するエポキシ樹脂は硬化性(硬化速度)の点で好ましい。

【0033】

前記芳香族エポキシ樹脂の具体例としては、少なくとも1個の芳香族環を有する多価フェノールまたは、そのアルキレンオキサイド付加物のポリグリシジルエーテル、例えばビスフェノールA、ビスフェノールF、またはこれらに更にアルキレンオキサイドを付加した化合物のグリシジルエーテルやエポキシノボラック

樹脂などが挙げられる。

【0034】

また前記脂肪族エポキシ樹脂の具体例としては、脂肪族多価アルコールまたはそのアルキレンオキサイド付加物のポリグリシジルエーテル、脂肪族長鎖多塩基酸のポリグリシジルエステル、グリシジルアクリレートまたはグリシジルメタクリレートのビニル重合により合成したホモポリマー、グリシジルアクリレートまたはグリシジルメタクリレートとその他のビニルモノマーとのビニル重合により合成したコポリマー等が挙げられる。代表的な化合物として、1, 4-ブタンジオールジグリシジルエーテル、1, 6-ヘキサジオールジグリシジルエーテル、グリセリンのトリグリシジルエーテル、トリメチロールプロパンのトリグリシジルエーテル、ソルビトールのテトラグリシジルエーテル、ジペンタエリスリトールのヘキサグリシジルエーテル、ポリエチレングリコールのジグリシジルエーテル、ポリプロピレングリコールのジグリシジルエーテルなどの多価アルコールのグリシジルエーテル、またプロピレングリコール、トリメチロールプロパン、グリセリン等の脂肪族多価アルコールに1種または2種以上のアルキレンオキサイドを付加することによって得られるポリエーテルポリオールのポリグリシジルエーテル、脂肪族長鎖二塩基酸のジグリシジルエステルが挙げられる。さらに、脂肪族高級アルコールのモノグリシジルエーテルやフェノール、クレゾール、ブチルフェノール、また、これらにアルキレンオキサイドを付加することによって得られるポリエーテルアルコールのモノグリシジルエーテル、高級脂肪酸のグリシジルエステル、エポキシ化大豆油、エポキシステアリン酸オクチル、エポキシステアリン酸ブチル、エポキシ化大豆油、エポキシ化ポリブタジエン等が挙げられる。

【0035】

前記芳香族及び脂肪族エポキシ樹脂として好適に使用できる市販品としてはエピコート801、エピコート828（以上、油化シェルエポキシ社製）、PY-306、0163、DY-022（以上、チバガイギー社製）、KRM-2720、EP-4100、EP-4000、EP-4080、EP-4900、ED-505、ED-506（以上、旭電化工業（株）製）、エポライトM-123

0、エポライト EHDG-L、エポライト 40E、エポライト 100E、エポライト 200E、エポライト 400E、エポライト 70P、エポライト 200P、エポライト 400P、エポライト 1500NP、エポライト 1600、エポライト 80MF、エポライト 100MF、エポライト 4000、エポライト 3002、エポライト FR-1500（以上、共栄社化学（株）製）、サントート ST0000、YD-716、YH-300、PG-202、PG-207、YD-172、YDPN638（以上、東都化成（株）製）などを挙げるができる。

【0036】

前記オキセタン化合物の具体例としては、例えば以下の化合物を挙げるができる。3-エチル-3-ヒドロキシメチルオキセタン、3-(メタ)アリルオキシメチル-3-エチルオキセタン、(3-エチル-3-オキセタニルメトキシ)メチルベンゼン、4-フルオロ-[1-(3-エチル-3-オキセタニルメトキシ)メチル]ベンゼン、4-メトキシ-[1-(3-エチル-3-オキセタニルメトキシ)メチル]ベンゼン、[1-(3-エチル-3-オキセタニルメトキシ)エチル]フェニルエーテル、イソブトキシメチル(3-エチル-3-オキセタニルメチル)エーテル、イソボルニルオキシエチル(3-エチル-3-オキセタニルメチル)エーテル、イソボルニル(3-エチル-3-オキセタニルメチル)エーテル、2-エチルヘキシル(3-エチル-3-オキセタニルメチル)エーテル、エチルジエチレングリコール(3-エチル-3-オキセタニルメチル)エーテル、ジシクロペンタジエン(3-エチル-3-オキセタニルメチル)エーテル、ジシクロペンテニルオキシエチル(3-エチル-3-オキセタニルメチル)エーテル、ジシクロペンテニル(3-エチル-3-オキセタニルメチル)エーテル、テトラヒドロフルフリル(3-エチル-3-オキセタニルメチル)エーテル、テトラプロモフェニル(3-エチル-3-オキセタニルメチル)エーテル、2-テトラプロモフェノキシエチル(3-エチル-3-オキセタニルメチル)エーテル、トリプロモフェニル(3-エチル-3-オキセタニルメチル)エーテル、2-トリプロモフェノキシエチル(3-エチル-3-オキセタニルメチル)エーテル、2-ヒドロキシエチル(3-エチル-3-オキセタニルメチル)エーテル、2-ヒドロキシプロピル(3-エチル-3-オキセタニルメチル)エーテル、

ブトキシエチル (3-エチル-3-オキセタニルメチル) エーテル、ペンタクロロフェニル (3-エチル-3-オキセタニルメチル) エーテル、ペンタブロモフェニル (3-エチル-3-オキセタニルメチル) エーテル、ボルニル (3-エチル-3-オキセタニルメチル) エーテル、3, 7-ビス (3-オキセタニル) -5-オキサノナン、3, 3' - (1, 3- (2-メチレニル) プロパンジイルビス (オキシメチレン)) ビス- (3-エチルオキセタン) 、1, 4-ビス [(3-エチル-3-オキセタニルメトキシ) メチル] ベンゼン、1, 2-ビス [(3-エチル-3-オキセタニルメトキシ) メチル] エタン、1, 3-ビス [(3-エチル-3-オキセタニルメトキシ) メチル] プロパン、エチレングリコールビス (3-エチル-3-オキセタニルメチル) エーテル、ジシクロペンテニルビス (3-エチル-3-オキセタニルメチル) エーテル、トリエチレングリコールビス (3-エチル-3-オキセタニルメチル) エーテル、テトラエチレングリコールビス (3-エチル-3-オキセタニルメチル) エーテル、トリシクロデカンジイルジメチレン (3-エチル-3-オキセタニルメチル) エーテル、トリメチロールプロパントリス (3-エチル-3-オキセタニルメチル) エーテル、1, 4-ビス (3-エチル-3-オキセタニルメトキシ) ブタン、1, 6-ビス (3-エチル-3-オキセタニルメトキシ) ヘキサン、ペンタエリスリトールトリス (3-エチル-3-オキセタニルメチル) エーテル、ペンタエリスリトールテトラキス (3-エチル-3-オキセタニルメチル) エーテル、ポリエチレングリコールビス (3-エチル-3-オキセタニルメチル) エーテル、ジペンタエリスリトールヘキサキス (3-エチル-3-オキセタニルメチル) エーテル、ジペンタエリスリトールペンタキス (3-エチル-3-オキセタニルメチル) エーテル、ジペンタエリスリトールテトラキス (3-エチル-3-オキセタニルメチル) エーテル、カプロラクトン変性ジペンタエリスリトールヘキサキス (3-エチル-3-オキセタニルメチル) エーテル、カプロラクトン変性ジペンタエリスリトールペンタキス (3-エチル-3-オキセタニルメチル) エーテル、ジトリメチロールプロパントテトラキス (3-エチル-3-オキセタニルメチル) エーテル、EO変性ビスフェノールAビス (3-エチル-3-オキセタニルメチル) エーテル、PO変性ビスフェノールAビス (3-エチル-3-オキセタニルメチル) エー

テル、EO変性水添ビスフェノールAビス(3-エチル-3-オキセタニルメチル)エーテル、PO変性水添ビスフェノールAビス(3-エチル-3-オキセタニルメチル)エーテル、EO変性ビスフェノールF(3-エチル-3-オキセタニルメチル)エーテルなどを例示することができ、これらは1種単独あるいは2種以上を組み合わせて用いることができる。これら、オキセタン化合物は特に可撓性を必要とする場合に使用すると効果的であり好ましい。

【0037】

本発明の光学的立体造形用樹脂組成物に使用する(1)カチオン重合性有機物質としては、上記の光重合性組成物の成分としてのカチオン重合性有機物質を同様に使用することができる。

【0038】

また、本発明の光学的立体造形用樹脂組成物としては、上記のエポキシ化合物の中では分子中にシクロヘキセンオキシド構造を有するエポキシ化合物を、カチオン重合性有機物質全量に対して30重量%以上用いるのが硬化性(硬化速度)、造形精度の点で特に好ましい。残りの70重量%未満のカチオン重合性有機物質成分は、その他のエポキシ樹脂や、以下に例示するエポキシ化合物以外のカチオン重合性有機物質であってよい。なお、エポキシ化合物以外のカチオン重合性有機物質と上記シクロヘキセンオキシド化合物の混合物も好ましい。

【0039】

本発明で用いることができる(1)カチオン重合性有機物質のエポキシ化合物以外の具体例としては、上記オキセタン化合物、テトラヒドロフラン、2,3-ジメチルテトラヒドロフランなどのオキサラン化合物、トリオキサン、1,3-ジオキサラン、1,3,6-トリオキサンシクロオクタンなどの環状アセタール化合物、 β -プロピオラクトン、 ϵ -カプロラクトンなどの環状ラクトン化合物、エチレンスルフィド、チオエピクロルヒドリンなどのチイラン化合物、1,3-プロピンスルフィド、3,3-ジメチルチエタンなどのチエタン化合物、テトラヒドロチオフェン誘導体などの環状チオエーテル化合物、エチレングリコールジビニルエーテル、アルキルビニルエーテル、2-クロロエチルビニルエーテル、2-ヒドロキシエチルビニルエーテル、トリエチレングリコールジビニルエー

テル、1, 4-シクロヘキサンジメタノールジビニルエーテル、ヒドロキシブチルビニルエーテル、プロピレングリコールのプロペニルエーテルなどのビニルエーテル化合物、エポキシ化合物とラクトンの反応によって得られるスピロオルトエステル化合物、スチレン、ビニルシクロヘキセン、イソプチレン、ポリブタジエンなどのエチレン性不飽和化合物および上記誘導体などが挙げられる。

【0040】

また、光重合性組成物として、特に可撓性を必要とする場合は、(1) カチオン重合性有機物質として上記オキセタン化合物を、カチオン重合性有機物質全量に対して30重量%以上用いるのが好ましい。その他の70重量%未満のカチオン重合性有機物質の成分は、エポキシ樹脂等、オキセタン化合物以外の上記カチオン重合性有機物質であってよい。

【0041】

なお本発明においては、(1) カチオン重合性有機物質として、上述したカチオン性有機化合物のうち1種または2種以上を配合して使用することができる。

【0042】

本発明の光酸発生剤を光重合開始剤として使用する場合は、通常用いられている範囲で制限なく使用できるが、カチオン重合性有機物質100重量部に対して0.05~10重量部の割合で用いることが好ましい。但し、カチオン重合性有機物質の性質、光の照射強度、硬化に要する時間、硬化物の物性、コストなどの要因により、配合量を上述の範囲より増減させて用いることも可能である。

【0043】

本発明の光重合性組成物には必要に応じてアクリル樹脂、不飽和ポリエステル樹脂などラジカル重合性の光重合組成物を混合して用いることもできる。

【0044】

本発明の光重合性組成物には必要に応じて、あるいは所望により、アントラセン誘導体、ピレン誘導体などの光増感剤、熱感応カチオン重合開始剤、充填剤、希釈剤、溶剤、顔料、可撓性付与剤、消泡剤、レベリング剤、増粘剤、安定剤、難燃剤、酸化防止剤などの添加剤を加えることができる。

【0045】

本発明の光重合性組成物は広範囲の応用分野に有用であり、例えば平版、凸版用印刷板の作成、プリント基板やIC、LSI作成のためのフォトレジスト、レリーフ像や画像複製等の画像形成、光硬化性のインキ、塗料、接着剤などに用いることができる。

【0046】

また本発明の、光学的立体造形用樹脂組成物の場合、以上のような(2)エネルギー線感受性カチオン重合開始剤は、(1)カチオン重合性有機物質に対して、好ましくは0.05~10重量%、より好ましくは0.1~10重量%配合されるのがよい。この範囲を上回ると十分な強度を有する硬化物が得られず、下回ると樹脂が十分硬化しない場合がある。

【0047】

本発明の光重合性組成物に使用する(3)ラジカル重合性有機物質とは、エネルギー線感受性ラジカル重合開始剤の存在下、エネルギー線照射により高分子化または架橋反応するラジカル重合性有機物質で、好ましくは1分子中に少なくとも1個以上の不飽和二重結合を有する化合物である。

【0048】

かかる化合物としては、例えばアクリレート化合物、メタクリレート化合物、アリルウレタン化合物、不飽和ポリエステル化合物、スチレン系化合物等が挙げられる。

【0049】

かかるラジカル重合性有機物質の中でも(メタ)アクリル基を有する化合物は、合成、入手が容易であり、取り扱いが容易であり好ましい。例えばエポキシ(メタ)アクリレート、ウレタン(メタ)アクリレート、ポリエステル(メタ)アクリレート、ポリエーテル(メタ)アクリレート、アルコール類の(メタ)アクリル酸エステルが挙げられる。

【0050】

ここで、エポキシ(メタ)アクリレートとは、例えば、従来公知の芳香族エポキシ樹脂、脂環式エポキシ樹脂、脂肪族エポキシ樹脂などと、(メタ)アクリル酸とを反応させて得られるアクリレートである。これらのエポキシ(メタ)アク

リレートのうち、特に好ましいものは、芳香族エポキシ樹脂の(メタ)アクリレートであり、少なくとも1個の芳香核を有する多価フェノールまたはそのアルキレンオキサイド付加体のポリグリシジルエーテルを、(メタ)アクリル酸と反応させて得られる(メタ)アクリレートである。例えば、ビスフェノールA、またはそのアルキレンオキサイド付加体をエピクロロヒドリンとの反応によって得られるグリシジルエーテルを、(メタ)アクリル酸と反応させて得られる(メタ)アクリレート、エポキシノボラック樹脂と(メタ)アクリル酸を反応して得られる(メタ)アクリレート等が挙げられる。

【0051】

ウレタン(メタ)アクリレートとして好ましいものは、1種または2種以上の水酸基含有ポリエステルや水酸基含有ポリエーテルに水酸基含有(メタ)アクリル酸エステルとイソシアネート類を反応させて得られる(メタ)アクリレートや、水酸基含有(メタ)アクリル酸エステルとイソシアネート類を反応させて得られる(メタ)アクリレート等である。

【0052】

ここで使用する水酸基含有ポリエステルとして好ましいものは、1種または2種以上の脂肪族多価アルコールと、1種または2種以上の多塩基酸との反応によって得られる水酸基含有ポリエステルであって、脂肪族多価アルコールとしては、例えば1,3-ブタンジオール、1,4-ブタンジオール、1,6-ヘキサンジオール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、ネオペンチルグリコール、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、トリメチロールプロパン、グリセリン、ペンタエリスリトール、ジペンタエリスリトールなどが挙げられる。多塩基酸としては、例えば、アジピン酸、テレフタル酸、無水フタル酸、トリメリット酸などが挙げられる。

【0053】

水酸基含有ポリエーテルとして好ましいものは、脂肪族多価アルコールに1種または2種以上のアルキレンオキサイドを付加することによって得られる水酸基含有ポリエーテルであって、脂肪族多価アルコールとしては、前述した化合物と同様のものが例示できる。アルキレンオキサイドとしては、例えば、エチレンオ

キサイド、プロピレンオキサイドが挙げられる。

【0054】

水酸基含有（メタ）アクリル酸エステルとして好ましいものは、脂肪族多価アルコールと（メタ）アクリル酸のエステル化反応によって得られる水酸基含有（メタ）アクリル酸エステルであって、脂肪族多価アルコールとしては、前述した化合物と同様のものが例示できる。

【0055】

かかる水酸基含有（メタ）アクリル酸のうち、脂肪族二価アルコールと（メタ）アクリル酸とのエステル化反応によって得られる水酸基含有（メタ）アクリル酸エステルは特に好ましく、例えば2-ヒドロキシエチル（メタ）アクリレートが挙げられる。

【0056】

イソシアネート類としては、分子中に1個以上のイソシアネート基を持つ化合物が好ましく、トリレンジイソシアネートや、ヘキサメチレンジイソシアネート、イソホロンジイソシアネートなどの2価のイソシアネート化合物が特に好ましい。

【0057】

ポリエステル（メタ）アクリレートとして好ましいものは、水酸基含有ポリエステルと（メタ）アクリル酸とを反応させて得られるポリエステル（メタ）アクリレートである。ここで使用する水酸基含有ポリエステルとして好ましいものは、1種または2種以上の脂肪族多価アルコールと、1種または2種以上の1塩基酸、多塩基酸、及びフェノール類とのエステル化反応によって得られる水酸基含有ポリエステルであって、脂肪族多価アルコールとしては、前述した化合物と同様のものが例示できる。1塩基酸としては、例えば、ギ酸、酢酸、ブチルカルボン酸、安息香酸等が挙げられる。多塩基酸としては、例えば、アジピン酸、テレフタル酸、無水フタル酸、トリメリット酸等が挙げられる。フェノール類としては、例えば、フェノール、p-ノニルフェノール、ビスフェノールA等が挙げられる。ポリエーテル（メタ）アクリレートとして好ましいものは、水酸基含有ポリエーテルと、メタ（アクリル）酸とを反応させて得られるポリエーテル（メタ

）アクリレートである。ここで使用する水酸基含有ポリエーテルとして好ましいものは、脂肪族多価アルコールに1種または2種以上のアルキレンオキサイドを付加することによって得られる水酸基含有ポリエーテルであって、脂肪族多価アルコールとしては、前述した化合物と同様のものが例示できる。アルキレンオキサイドとしては、例えば、エチレンオキサイド、プロピレンオキサイド等が挙げられる。

【0058】

アルコール類の（メタ）アクリル酸エステルとして好ましいものは、分子中に少なくとも1個の水酸基を持つ芳香族または脂肪族アルコール、及びそのアルキレンオキサイド付加体と（メタ）アクリル酸とを反応させて得られる（メタ）アクリレートであり、例えば、2-エチルヘキシル（メタ）アクリレート、2-ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、2-ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、イソアミル（メタ）アクリレート、ラウリル（メタ）アクリレート、ステアリル（メタ）アクリレート、イソオクチル（メタ）アクリレート、テトラヒドロフルフリル（メタ）アクリレート、イソボニル（メタ）アクリレート、ベンジル（メタ）アクリレート、1,3-ブタンジオールジ（メタ）アクリレート、1,4-ブタンジオールジ（メタ）アクリレート、1,6-ヘキサンジオールジ（メタ）アクリレート、ジエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、トリエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、ネオペンチルグリコールジ（メタ）アクリレート、ポリエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、ポリプロピレングリコールジ（メタ）アクリレート、トリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールテトラ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサ（メタ）アクリレート、 ϵ -カプロラクトン変性ジペンタエリスリトールヘキサ（メタ）アクリレート等が挙げられる。

【0059】

これらの（メタ）アクリレートのうち、多価アルコールのポリ（メタ）アクリレート類が特に好ましい。

【0060】

これらラジカル重合性有機物質の市販品としては、単官能の例として、アロニ

ックスM-101、M-102、M-111、M-113、M-117、M-152、TO-1210（以上、東亜合成（株）製）、KAYARAD TC-110S、R-564、R-128H（以上、日本化薬（株）製）、ビスコート192、ビスコート220、ビスコート2311HP、ビスコート2000、ビスコート2100、ビスコート2150、ビスコート8F、ビスコート17F（以上、大阪有機化学工業（株）製）などを挙げることができる。

【0061】

また、多官能の例として、SA1002（以上、三菱化学（株）製）、ビスコート195、ビスコート230、ビスコート260、ビスコート215、ビスコート310、ビスコート214HP、ビスコート295、ビスコート300、ビスコート360、ビスコートGPT、ビスコート400、ビスコート700、ビスコート540、ビスコート3000、ビスコート3700（以上、大阪有機化学工業（株）製）、カヤラッドR-526、HDDA、NPGDA、TPGDA、MANDA、R-551、R-712、R-604、R-684、PET-30、GPO-303、TMP TA、THE-330、DPHA、DPHA-2H、DPHA-2C、DPHA-2I、D-310、D-330、DPCA-20、DPCA-30、DPCA-60、DPCA-120、DN-0075、DN-2475、T-1420、T-2020、T-2040、TPA-320、TPA-330、RP-1040、RP-2040、R-011、R-300、R-205（以上、日本化薬（株）製）、アロニックスM-210、M-220、M-233、M-240、M-215、M-305、M-309、M-310、M-315、M-325、M-400、M-6200、M-6400（以上、東亜合成（株）製）、ライトアクリレートBP-4EA、BP-4PA、BP-2EA、BP-2PA、DCP-A（以上、共栄社化学（株）製）、ニューフロンティアBPE-4、TEICA、BR-42M、GX-8345（以上、第一工業製薬（株）製）、ASF-400（以上、新日鉄化学（株）製）、リポキシSP-1506、SP-1507、SP-1509、VR-77、SP-4010、SP-4060（以上、昭和高分子（株）製）、NKエステルA-BPE-4（以上、新中村化学工業（株）製）などを挙げることができる。

【0062】

これらのラジカル重合性有機物質は1種あるいは2種以上のものを所望の性能に応じて、配合して使用することができる。

【0063】

ラジカル重合性有機物質のうち50重量%以上が、分子中に(メタ)アクリル基を有する化合物であることが好ましい。

【0064】

本発明におけるラジカル重合性有機物質の配合は、カチオン重合性有機物質100重量部に対して200重量部以下であることが好ましく、10~100重量部であることが特に好ましい。

【0065】

本発明に使用する(4)エネルギー線感受性ラジカル重合開始剤は、エネルギー線照射を受けることによってラジカル重合を開始させることが可能となる化合物であればよく、例えば、アセトフェノン系化合物、ベンジル系化合物、チオキサントン系化合物などのケトン系化合物を好ましいものとして例示することができる。

【0066】

アセトフェノン系化合物としては例えば、ジエトキシアセトフェノン、2-ヒドロキシ-2-メチル-1-フェニルプロパン-1-オン、4'-イソプロピル-2-ヒドロキシ-2-メチルプロピオフェノン、2-ヒドロキシメチル-2-メチルプロピオフェノン、2,2-ジメトキシ-1,2-ジフェニルエタン-1-オン、p-ジメチルアミノアセトフェノン、p-ターシャリブチルジクロロアセトフェノン、p-ターシャリブチルトリクロロアセトフェノン、p-アジドベンザルアセトフェノン、1-ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、2-メチル-1-[4-(メチルチオ)フェニル]-2-モルフォリノプロパノン-1、2-ベンジル-2-ジメチルアミノ-1-(4-モルフォリノフェニル)-ブタノン-1、ベンゾイン、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインエチルエーテル、ベンゾインイソプロピルエーテル、ベンゾイン-n-ブチルエーテル、ベンゾインイソブチルエーテル、1-[4-(2-ヒドロキシエトキシ)-フェニル]

] -2-ヒドロキシ-2-メチル-1-プロパン-1-オン等が挙げられる。

【0067】

ベンジル系化合物としては、ベンジル、アニシル等が挙げられる。

【0068】

ベンゾフェノン系化合物としては、例えば、ベンゾフェノン、o-ベンゾイル安息香酸メチル、ミヒラーケトン、4, 4'-ビスジエチルアミノベンゾフェノン、4, 4'-ジクロロベンゾフェノン、4-ベンゾイル-4'-メチルジフェニルスルフィドなどが挙げられる。

【0069】

チオキサントン系化合物としては、チオキサントン、2-メチルチオキサントン、2-エチルチオキサントン、2-クロロチオキサントン、2-イソプロピルチオキサントン、2, 4-ジエチルチオキサントン等が挙げられる。

【0070】

その他のエネルギー線感受性ラジカル重合開始剤としては、2, 4, 6-トリメチルベンゾイルジフェニルフォスフェインオキサイド、ビス(シクロペンタジエニル)-ビス[2, 6-ジフルオロ-3-(ピル-1-イル)]チタニウムなどが挙げられる。

【0071】

これらのエネルギー線感受性ラジカル重合開始剤は1種あるいは2種以上のものを所望の性能に応じて配合して使用することができる。

【0072】

以上のような(4)エネルギー線感受性ラジカル重合開始剤は、(3)ラジカル重合性有機物質に対して化学量論的必要量を使用すればよいが、好ましくは(3)ラジカル重合性有機物質に対して0.05~10重量%、さらに好ましくは0.1~10重量%配合するのがよい。この範囲を上回ると十分な強度を有する硬化物が得られず、下回ると樹脂が十分硬化しない場合がある。

【0073】

本発明の光学的立体造形用樹脂組成物に使用する(3)ラジカル重合性有機物質と(4)エネルギー線感受性ラジカル重合開始剤としては、上記の光重合性組

成物の成分としてのものを同様に使用することができる。

【0074】

上記の(4)エネルギー線感受性ラジカル重合開始剤と(3)ラジカル重合性有機物質とを配合した本発明の光学的立体造形用樹脂組成物は、これらを配合しない場合に比べて、光学的立体造形を行った際の硬化速度が更に上昇し、光学的立体造形用樹脂組成物として好ましいものとなる。

【0075】

本発明の光重合性組成物には、任意の成分として(5)1分子中に2個以上の水酸基を有する有機化合物、(6)熱可塑性高分子化合物などを配合することができる。

【0076】

上記(5)1分子中に2個以上の水酸基を含有する有機化合物としては、多価アルコール、水酸基含有ポリエーテル、水酸基含有ポリエステル、多価フェノールなどが好ましい。

【0077】

多価アルコールの例としては、エチレングリコール、プロピレングリコール、ネオペンチルグリコール、トリメチロールプロパン、グリセリン、ペンタエリスリトール、ジペンタエリスリトール、1,3-ブタンジオール、1,4-ブタンジオール、1,6-ヘキサジオール、1,4-シクロヘキサジメタノール、4,8-ビス(ヒドロキシメチル)トリシクロ[5,2,1,0^{2.6}]デカン等が挙げられる。

【0078】

水酸基含有ポリエーテルとは、1種または2種以上の多価アルコールまたは多価フェノールに1種または2種以上のアルキレンオキサイドを付加して得られる化合物である。これに用いられる多価アルコール、多価フェノールの例としては、エチレングリコール、プロピレングリコール、ネオペンチルグリコール、トリメチロールプロパン、グリセリン、ペンタエリスリトール、ジペンタエリスリトール、1,3-ブタンジオール、1,4-ブタンジオール、1,6-ヘキサジオール、ビスフェノールA、ビスフェノールF、フェノールノボラック、クレゾ

ールノボラック等が挙げられる。またアルキレンオキサイドの例としては、プロピレンオキサイド、エチレンオキサイドなどが挙げられる。

【0079】

水酸基含有ポリエステルとしては、1種または2種以上の多価アルコール及び／又は多価フェノールと1種または2種以上の1塩基酸、多塩基酸などとのエステル化反応によって得られる水酸基含有ポリエステル、および1種または2種以上のラクトン類と、1種または2種以上の多価アルコールとのエステル化反応によって得られる水酸基含有ポリエステルが挙げられる。多価アルコール、多価フェノールの例としては、前述のものと同様のものが挙げられる。1塩基酸としては、例えばギ酸、酢酸、ブチルカルボン酸、安息香酸などが挙げられる。多塩基酸としては、例えばアジピン酸、テレフタル酸、トリメリット酸などが挙げられる。ラクトン類としては、 β -プロピオラクトン、 ϵ -カプロラクトンなどが挙げられる。多価フェノールとは、芳香環に直接結合した水酸基を1分子中に2個以上含有する化合物である。例えば、ビスフェノールA、ビスフェノールF、フェノールノボラック樹脂、クレゾールノボラック樹脂などが挙げられる。

【0080】

これらの(5) 1分子中に2個以上の水酸基を含有する有機化合物は、単独あるいは2種以上の物を所望の性能に応じて使用することができる。

【0081】

この(5) 1分子中に2個以上の水酸基を含有する有機化合物の好ましい配合量は、組成物中の(1) カチオン重合性有機物質100重量部に対して1～50重量部である。

【0082】

上記(6) 熱可塑性高分子化合物としては、室温において液体または固体であり、室温において樹脂組成物と均一に混和する高分子化合物である。

【0083】

この(6) 熱可塑性高分子化合物の代表的なものとしては、ポリエステル、ポリ酢酸ビニル、ポリ塩化ビニル、ポリブタジエン、ポリカーボナート、ポリスチレン、ポリビニルエーテル、ポリビニルブチラール、ポリアクリレート、ポリメ

チルメタクリレート、ポリブテン、スチレンブタジエンブロックコポリマー水添物などが挙げられる。

【0084】

また、これらの(6)熱可塑性高分子化合物に水酸基、カルボキシル基、ビニル基、エポキシ基などの官能基が導入されたものを用いることもできる。

【0085】

本発明の光学的立体造形用樹脂組成物に使用する(5)1分子中に2個以上の水酸基を有する有機化合物と(6)熱可塑性高分子化合物としては、上記の光重合性組成物の成分としてのものを同様に使用することができる。

【0086】

(6)熱可塑性高分子化合物について本発明に対して望ましい数平均分子量は1000～500000であり、さらに好ましい数平均分子量は5000～100000である。この範囲外であっても使用できないわけではないが、あまり低分子量であると強度を改善するという効果が十分得られず、あまり高分子量であっては組成物の粘度が高くなり、光学的立体造形用樹脂組成物として好ましいものとは言えなくなる。

【0087】

また、(6)熱可塑性高分子化合物の配合量は、組成物全体を基準にして5～50重量%、好ましくは5～30重量%がよい。これより少ないと、熱可塑性高分子化合物を添加しない場合と有意な差がなく、逆にこれより多いと樹脂組成物の粘度が高くなり、光学的立体造形用樹脂組成物として好ましいものとは言えなくなる。

【0088】

(6)熱可塑性高分子化合物を配合した本発明の立体造形用樹脂組成物は、これらを配合しない場合に比べて、光学的立体造形を行った際の硬化物の機械物性が更に上昇し、光学的立体造形用樹脂組成物として好ましいものとなる。

【0089】

本発明の光重合性組成物、更には光学的立体造形用樹脂組成物には、必須ではないが必要に応じて光増感剤などを配合することができる。例えば、アントラセ

ン誘導体、ピレン誘導体等の光増感剤を併用することにより、これらを配合しない場合に比べて光造形を行った際の硬化速度がさらに向上し、樹脂組成物として好ましいものになる。

【0090】

また、本発明の効果を損なわない限り、必要に応じて熱感応性カチオン重合開始剤、無機フィラー、有機フィラー、顔料、染料などの着色剤、レベリング剤、消泡剤、増粘剤、難燃剤、酸化防止剤、安定剤等の各種樹脂添加物等を添加することができる。上記熱感応性カチオン重合開始剤としては、例えば特開昭57-49613号、特開昭58-37004号公報記載の脂肪族オニウム塩類が挙げられる。

【0091】

本発明においては、本発明の効果を阻害しない範囲で所望により、上記のような熱感応性カチオン重合開始剤、無機フィラー、有機フィラー、顔料、染料などの着色剤、レベリング剤、消泡剤、増粘剤、難燃剤、酸化防止剤、安定剤等の各種樹脂添加物等を通常の使用の範囲で併用することができるが、造形物の歪みの点で、本発明の光造形用樹脂組成物の総量に対して150重量%以下とするのが好ましい。

【0092】

本発明において上記光学的立体造形用樹脂組成物に照射する光は、紫外のレーザー光であることが好ましく、具体的にはHe-Cdレーザー、Arイオンレーザー、Nd発振の固体レーザーに非線形結晶を組み合わせることで1/3の波長にしたもの等が挙げられる。また、250～400nmの波長間の光の総合計エネルギー量に対して345～360nmの波長間の光の合計エネルギー量が70%以上であることがさらに好ましい。

【0093】

この場合、250nm未満、或いは400nmを超える波長の光は上記光学的立体造形用樹脂組成物の硬化、即ち(2)エネルギー線感受性カチオン重合開始剤の活性化に関与しないので不要であるが、所望により併用しても差し支えない。

【0094】

従って、上記光学的立体造形用樹脂組成物の硬化、即ち（２）エネルギー線感受性カチオン重合開始剤の活性化には250～400nmの波長間の光の総合計エネルギー量が、その必要量以上あればよい。

【0095】

250～400nmの波長間の光の総合計エネルギー量に対して345～360nmの波長間の光の合計エネルギー量が70%以上でないと、光が十分に吸収されず、所望とする硬化深度が大きくなり、非設計部位を硬化させる、所謂余剰硬化部が大きくなってしまう。

【0096】

250～400nmの波長間の光の総合計エネルギー量に対して345～360nmの波長間の光の合計エネルギー量が70%以上である光は、具体的には例えば、Nd発振固体レーザー（例えばNd-YVO₄レーザー、Nd-YAGレーザー等）に非線形結晶を組み合わせて1/3の波長（355nm）に変換した光（レーザー光）や、アルゴンイオンレーザー（333nm、351nm、364nmの波長の光からなる）光をフィルター処理などして351nmリッチにした光等として得ることができる。

【0097】

本発明の光学的立体造形方法を行なうには、まず上記光学的立体造形用樹脂組成物の必須構成成分、必要に応じて任意の成分、その他の材料から上記光学的立体造形用樹脂組成物を得る。

【0098】

この工程は周知の工程によるのがよいが、例えば、これらの材料を十分混合する。具体的な混合方法としては、例えば、プロペラの回転に伴う攪拌力を利用する攪拌法やロール練り混込み法などが挙げられる。上記（１）～（４）の好ましい配合比、また必要に応じて配合される添加剤の種類及びその配合比は、上述した本発明の光学的立体造形用樹脂組成物と同じ範囲または種類を使用することができる。このようにして得られた光学的立体造形用樹脂組成物は概ね常温で液状である。

【0099】

次に、上記樹脂組成物の任意の表面に、エネルギー線を照射し、該樹脂組成物のエネルギー線照射表面を硬化させて所望の厚さの硬化層を形成し、該硬化層上に前述のエネルギー線硬化性樹脂組成物をさらに供給して、これを同様に硬化させて前述の硬化層と連続した硬化層を得る積層操作を行い、この操作を繰り返すことによって三次元の立体物を得る。

【0100】

さらに図を参照して具体的に説明すると、図1に示すように、NCテーブル2を樹脂5中に位置させ、テーブル2上に所望ピッチに相当する深度の未硬化樹脂層を形成する。次にCADデータを元に制御部1からの信号に従って光学系3を制御してレーザー4からのレーザー光線6を未硬化樹脂表面に走査照射して第1硬化層7を得る（図2参照）。次に制御部1からの信号に従ってNCテーブル2を降下させ、第1硬化層7上にさらに所望ピッチに相当する深度の未硬化樹脂層を形成する（図3参照）。同様にレーザー光線6を走査照射して第2硬化層8を得る（図4参照）。以下同様にして積層する。

【0101】

【実施例】

以下に、実施例によって本発明をさらに詳細に説明する。

〔合成例-1〕 2-(8-ベンゾイル-ジベンゾチオフェニル)-ジ-*p*-トリルスルホニウムヘキサフルオロアンチモネート（化合物1）の合成

【0102】

500mlの三口フラスコに塩化アルミニウム93.3g、ジベンゾチオフェン107.5g、1,2-ジクロロエタン650gを仕込んだ。ここへ塩化ベンゾイル82.0gを加え、25℃で2時間反応を行った。次いで、5000mlのビーカー中へ氷1000gを入れておき、この中に反応物を注ぎ入れた。1,2-ジクロロエタン層を1000gの水で3回洗浄した。1,2-ジクロロエタン層を減圧濃縮することにより、8-ベンゾイル-ジベンゾチオフェンが160.4g（収率95%）得られた。

【0103】

500 ml の三口フラスコに 95% 硫酸 295 g を加え攪拌しながら、ジ-*p*-トリルスルホキシド 46.0 g を仕込んだ。添加と同時に反応液は暗褐色となった。次いで、上記で得られた 8-ベンゾイル-ジベンゾチオフェンを 57.6 g 仕込んだ。そのまま室温で 10 時間攪拌を続けた。次いで 3000 ml のビーカーに氷 500 g とメタノール 500 g を混合しておき、ここに反応液を投入し、更にトルエン 300 g を加えた。下層を取り出し、塩化メチレン 500 g で抽出し、これに水 1000 g を加え攪拌した。ここに KSbF_6 を 36.8 g 添加し、2 時間攪拌した。塩化メチレン層を水 1000 g で 2 回洗浄後、減圧濃縮することによって 90.53 g の白色粉末 (収率 70%) を得た。

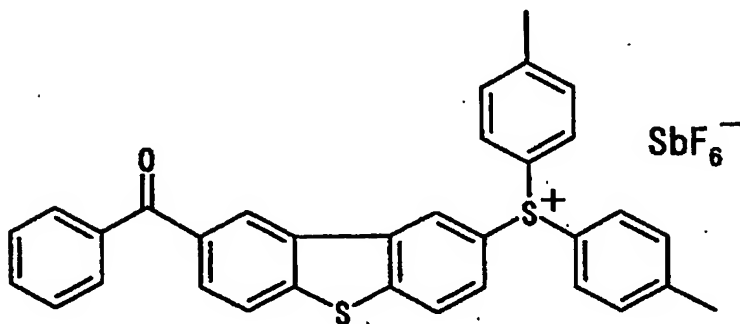
以下の分析結果から、この生成物は 2-(8-ベンゾイル-ジベンゾチオフェニル)-ジ-*p*-トリルスルホニウムヘキサフルオロアンチモネート (化合物 1: 下記構造) であると同定した。

・赤外吸収スペクトル (ケトン) $\nu(\text{C}=\text{O})$ 1654 cm^{-1}

元素分析	計算値	分析値
C	61.29%	61.96%
H	3.90%	4.18%
S	9.92%	10.23%
P	4.79%	4.45%

・その他、 ^1H -NMR、 ^{13}C -NMR により構造を同定した。

(化合物 1)



【0104】

〔合成例－2〕 2－（8－ベンゾイル－ジベンゾチオフェニル）－ジ－p－トリルスルホニウムヘキサフルオロホスフェート（化合物2：下記構造）の合成

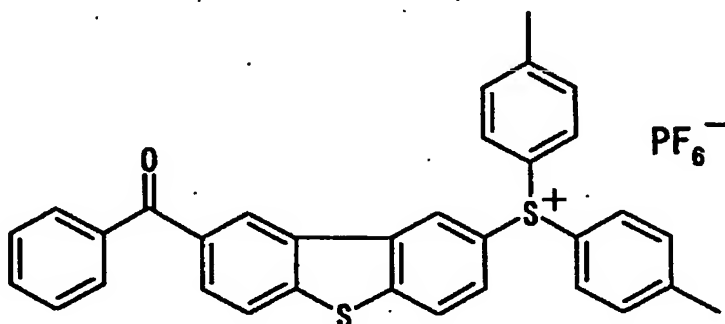
【0105】

合成例－1で KSbF_6 に代えて KPF_6 を使用することにより白色粉末として得られた。

【0106】

同定は、赤外吸収スペクトル、元素分析、 ^1H -NMR、 ^{13}C -NMRによって行った。

（化合物2）



【0107】

〔合成例－3〕 2－（8－ベンゾイル－ジベンゾチオフェニル）－ジ－p－フルオロフェニルスルホニウムヘキサフルオロアンチモネート（化合物3：下記構造）の合成

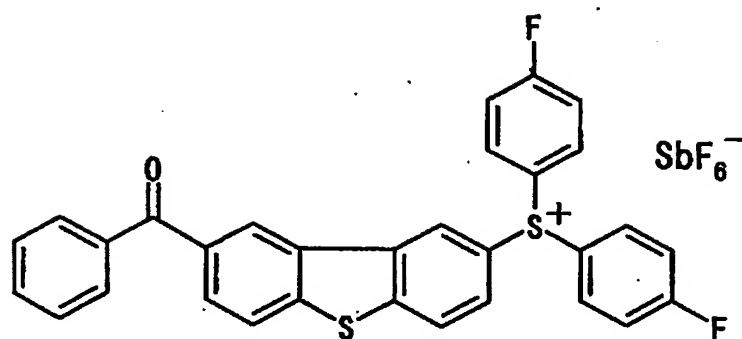
【0108】

合成例－1でジ－p－トリルスルホキシドに代えてジ－p－フルオロフェニルスルホキシドを使用することにより白色粉末として得られた。

【0109】

同定は、赤外吸収スペクトル、元素分析、 ^1H -NMR、 ^{13}C -NMRによって行った。

（化合物3）



【0110】

〔合成例－4〕 2－（8－ベンゾイル－ジベンゾチオフェニル）－ジ－p－フルオロフェニルスルホニウムヘキサフルオロホスフェート（化合物4：下記構造）の合成

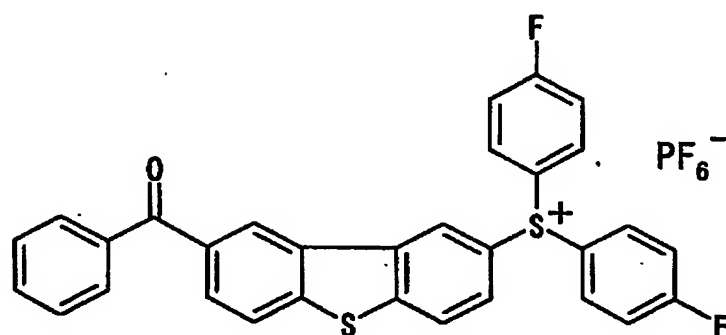
【0111】

合成例－2でジ－p－トリルスルホキシドに代えてジ－p－フルオロフェニルスルホキシドを使用することにより白色粉末として得られた。

【0112】

同定は、赤外吸収スペクトル、元素分析、 ^1H -NMR、 ^{13}C -NMRによって行った。

（化合物4）



【0113】

〔合成例－5〕 2－（8－ベンゾイル－ジベンゾチオフェニル）－ジフェニルスルホニウムヘキサフルオロアンチモネート（化合物5：下記構造）の合成

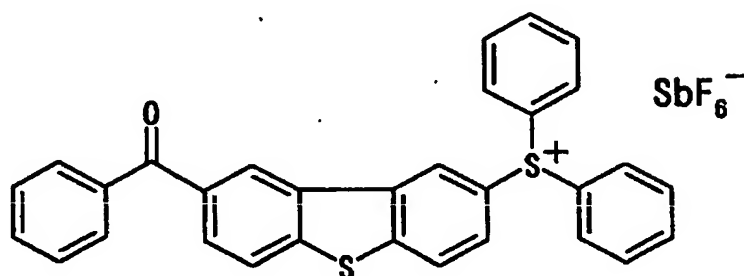
【0114】

合成例-1でジ-p-トリルスルホキシドに代えてジフェニルスルホキシドを使用することにより白色粉末として得られた。

【0115】

同定は、赤外吸収スペクトル、元素分析、 ^1H -NMR、 ^{13}C -NMRによって行った。

(化合物5)



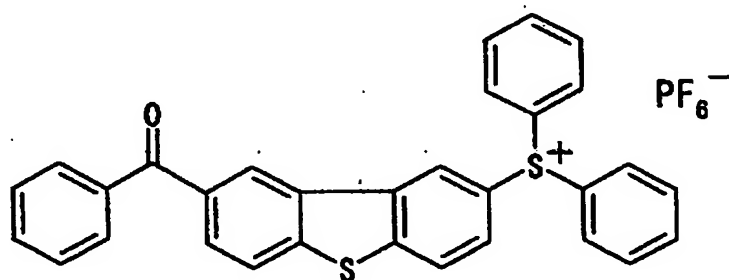
【0116】

〔合成例-6〕 2-(8-ベンゾイル-ジベンゾチオフェニル)-ジフェニルスルホニウムヘキサフルオロホスフェート (化合物6: 下記構造) の合成
合成例-2でジ-p-トリルスルホキシドに代えてジフェニルスルホキシドを使用することにより白色粉末として得られた。

【0117】

同定は、赤外吸収スペクトル、元素分析、 ^1H -NMR、 ^{13}C -NMRによって行った。

(化合物6)



【0118】

【合成例-7】 2-(8-ベンゾイル-ジベンゾチオフェニル)-ジ-*p*-ニトロフェニルスルホニウムヘキサフルオロアンチモネート(化合物7:下記構造)の合成

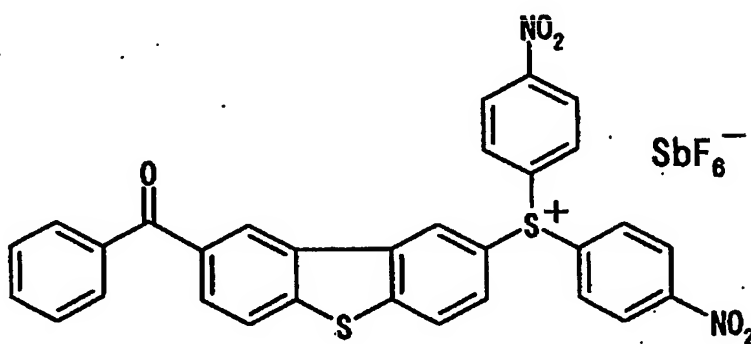
【0119】

合成例-1でジ-*p*-トリルスルホキシドに代えてジ-*p*-ニトロフェニルスルホキシドを使用することにより白色粉末として得られた。

【0120】

同定は、赤外吸収スペクトル、元素分析、 ^1H -NMR、 ^{13}C -NMRによって行った。

(化合物7)



【0121】

【合成例-8】 2-(8-ベンゾイル-ジベンゾチオフェニル)-ジ-*p*-ニトロフェニルスルホニウムヘキサフルオロホスフェート(化合物8:下記構造)の合成

【0122】

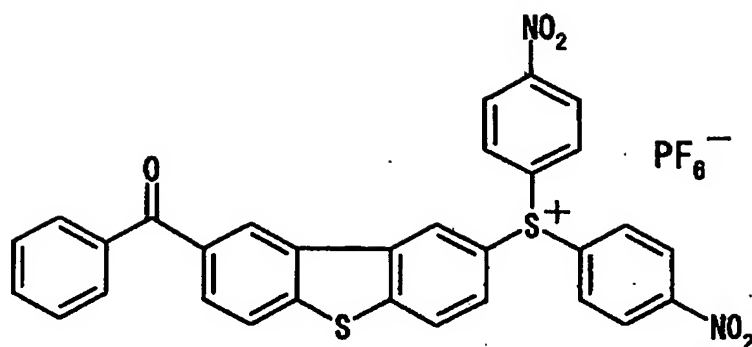
合成例-2でジ-*p*-トリルスルホキシドに代えてジ-*p*-ニトロフェニルスルホキシドを使用することにより白色粉末として得られた。

【0123】

同定は、赤外吸収スペクトル、元素分析、 ^1H -NMR、 ^{13}C -NMRによって行った。

【0124】

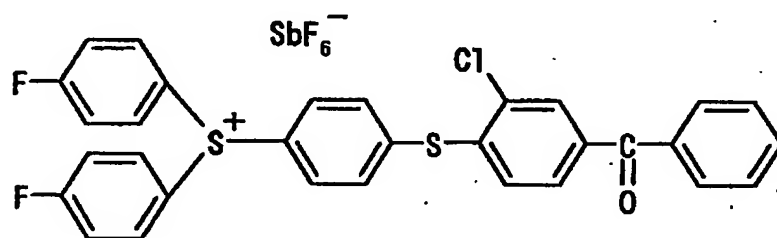
(化合物8)



尚、以下の実施例では、比較のため以下の化合物についても評価を行った。

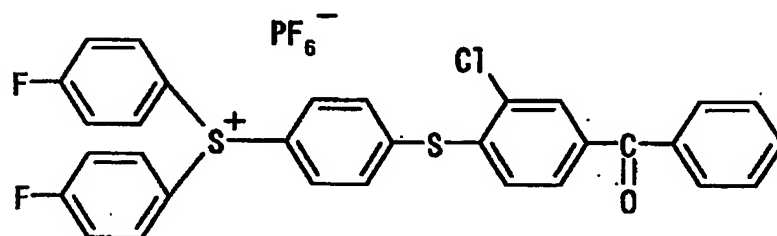
【0125】

(化合物9)



【0126】

(化合物10)



【0127】

実施例-1 分光照射試験

上記芳香族スルホニウム塩構造を有する化合物からなる光酸発生剤を3, 4-エポキシシクロヘキシルメチル-3, 4-エポキシシクロヘキシルカルボキシレ-

ート 100 g に対して、下記表 1 に示す量で添加して光重合性組成物を得た。これをバーコーター (No. 6) を用いてガラス板上に約 10 ミクロンの厚さに塗布して、日本分光株式会社製の分光照射装置 CT-25CP を用いて上記光重合性組成物の 365 nm における分光感度を測定した。

【0128】

この分光照射装置は 500 W 超高压水銀ランプと回折格子を内蔵し、365 nm の単色光を取り出すことができ、またその単色光を設定された時間露光できるシャッターで照射エネルギーを調節できる。シャッター出射口の直下には前記光重合性組成物を塗布したガラス板をセットできる移動ステージが設置され、シャッターと連動して移動し、13 段階の異なるエネルギーを光重合性組成物に照射することができる。

【0129】

照射された光重合性組成物を塗布したガラス板はメタノールで現像した。365 nm の光において硬化に必要な最小の硬化エネルギーをガラス板上に残った硬化膜段数と射出光量・シャッター開放時間より、求めた。得られた結果を表 1 に示す。

【0130】

【表 1】

化合物	添加量 (mmol)	感度 (必要硬化エネルギー) (365nm) (mJ/cm ²)
(1)	1.0	13
(2)	4.0	13
(3)	1.0	13
(4)	4.0	13
(5)	1.0	13
(6)	4.0	13
(7)	1.0	13
(8)	4.0	13
(9)	1.0	24
(10)	4.0	24

表 1 の結果から明らかな如く、従来公知であったスルホニウム塩 (9)、(10) に比較して、本発明による新規なスルホニウム塩 (1) ~ (8) はいずれも、長波長である 365 nm の光に対して、感度が優れていることが分かる。

【0131】

実施例 - 2

3, 4-エポキシシクロヘキシルメチル-3, 4-エポキシシクロヘキサンカルボキシレート 80 g、1, 4-ブタンジオールジグリシジルエーテル 20 g を混合した物に、上記表 1 に記載の化合物 (1) ~ (8) を光開始剤として同表 1 の添加量で添加し、良く攪拌して均一にした。これをアルミコート紙上に #3 のバーコーターで塗布した。これに、ベルトコンベア付の光照射装置を使用して 80 W/cm の高圧水銀灯の光を照射した。ランプからベルトコンベアまでの距離は 10 cm、ベルトコンベアのラインスピードは 8 cm/分とした。

【0132】

硬化後 24 時間室温に放置後、MEK (メチルエチルケトン) を付けた綿棒で塗膜を擦った。何れの樹脂でも 200 往復しても塗膜は侵されず、硬化が十分進行し、耐溶剤性が良好であることが分かった。

【0133】

実施例-3

3, 4-エポキシシクロヘキシルメチル-3, 4-エポキシシクロヘキサンカルボキシレート 80 g、1, 4-ブタンジオールジグリシジルエーテル 20 g を混合した物に、上記表 1 に記載の化合物 (1) ~ (8) を光開始剤として同表 1 の添加量で添加し、良く攪拌して均一にした。これを厚さ 50 マイクロメートルのポリエチレンテレフタレートフィルムに #3 のバーコーターで塗布した。これに、ベルトコンベア付の光照射装置を使用して 80 W/cm の高圧水銀灯の光を照射した。ランプからベルトコンベアまでの距離は 10 cm、ベルトコンベアのラインスピードは 8 cm/分とした。

【0134】

硬化後 24 時間室温に放置後、鉛筆硬度試験機を用い、荷重 1 kg で鉛筆硬度を測定した。その結果、何れも 2 H の硬度であった。

【0135】

次に、光学的立体造形用樹脂組成物および光学的立体造形法に関し、本発明の実施例と比較例を記載する。なお、本実施例、比較例では部は重量部を意味する。本実施例、比較例で行った実験を説明する。

【0136】

実験 1: 造形精度 (縦横方向) および造形性試験

樹脂組成物を可動 NC テーブル、光学系 (レーザーを含む)、制御用コンピュータからなる光造形用実験システムに入れ、この樹脂組成物から CAD データを元に、0.1 mm ピッチで縦 100 mm、横 100 mm、高さ 10 mm の中実の箱を作成し、縦横の長さの CAD データからのずれを測定した。また、このときの造形性や得られたモデルの外観も観察した。

【0137】

実験 2: 感度測定実験

実験 1 と同様の実験システムを用い、文献 (高速 3 次元成型の基礎、Paul F. Jacobs 編、著、日経 BP 出版センター (1993 年)、258 ページ) に記されている方法を用いて樹脂の感度測定を行った。

【0138】

実験3：造形精度試験（深さ方向の余剰硬化部の厚さ）

試験片の形状を変えた以外は実験1と同様の造形性試験を行った。即ち、図5に示す形状の試験片を作成した（図中、 $a = b = c = 10\text{ mm}$ 、 $d = 50\text{ mm}$ 、 $e = 5\text{ mm}$ ）。この試験片は、図示するように中央部に支えがない。よって、中央部の硬化時には光が十分吸収されないと下層へ達して余剰硬化部を形成する。余剰硬化部は硬化性が悪く他の部分と比較して硬度が低いので、造形後中央部の凹部の厚さをノギスで測定し、次いでナイフで軽く削り余剰硬化部を取り除き、再び厚さを測定し、この差から余剰部の厚さを求めた。

【0139】

実験4：機械強度測定

実験1と同様に、曲げ試験並びに衝撃試験用試験片を得た。得られた試験片を用い、JIS-6911に従って曲げ強さ及びアイゾット衝撃強さ（ノッチ付）、引っ張伸びを測定した。なお、実験に使用した材料は以下の通りである。

（1）カチオン重合性有機物質（「カチオン樹脂」と略記する）としては下記のカチオン樹脂1～5を用いた。

カチオン樹脂1：3，4-エポキシシクロヘキシルメチル-3，4-エポキシシクロヘキサンカルボキシレート

カチオン樹脂2：1，4-ブタンジオールジグリシジルエーテル

カチオン樹脂3：ビス（3，4-エポキシシクロヘキシルメチル）アジペート

カチオン樹脂4：ビスフェノールAジグリシジルエーテル

カチオン樹脂5：1，4-ビス〔（3-エチル-3-オキセタニルメトキシ）メチル〕ベンゼン

（2）エネルギー線感受性カチオン重合開始剤（「カチオン開始剤」と略記する）としては下記のカチオン開始剤1～3を用いた。

カチオン開始剤1：化合物1

カチオン開始剤2：化合物3

カチオン開始剤3：化合物9

（3）ラジカル重合性有機物質（「ラジカル樹脂」と略記する）としては下記の

ラジカル樹脂 1～3 を用いた。

ラジカル樹脂 1 : ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート

ラジカル樹脂 2 : ビスフェノール A エポキシ樹脂のアクリル化物

ラジカル樹脂 3 : トリメチロールプロパントリアクリレート

(4) エネルギー線感受性ラジカル重合開始剤 (「ラジカル開始剤」と略記する) としては下記のラジカル開始剤 1～2 を用いた。

ラジカル開始剤 1 : 2-ヒドロキシ-2-メチル-1-フェニルプロパン-1-オン

ラジカル開始剤 2 : 1-[4-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル]-2-ヒドロキシ-2-メチル-1-プロパン-1-オン

【0140】

実験に使用したレーザーは以下の 3 種類である。

Nd-YVO₄: Nd-YVO₄レーザーに非線形結晶を組み合わせ 1/3 の波長に変換したレーザー。波長 355 nm、パルス発振 (スペクトラフィジックス社製、商品名: BLIO-355Q)

Ar-1: 紫外線発振の Ar イオンレーザー。333、351、364 nm の混合波 (コヒーレント社製、商品名: INNOVA 325。351 nm 波のエネルギー量割合は 44%)

Ar-2: 紫外線発振の Ar イオンレーザー。351 nm を主とし、333 nm を少量含む混合波 (コヒーレント社製、商品名: INNOVA 325/0165-148-00。351 nm 波のエネルギー量割合は 76%)

【0141】

実施例 4～11、比較例 1

表 2 に示した配合比で樹脂を充分混合して光学的立体造形用樹脂組成物を得た。得られた樹脂組成物は淡黄色透明の液体である。得られた樹脂組成物を用い、表 2 に示すレーザーを用いて実験 1～4 を行った。得られた結果を下記の表 2 に示す。同様に実施例 5～11、比較例 1 について行なった。得られた結果を下記の表 2～4 に示す。

【0142】

【表 2】

	実施例 4	実施例 5	実施例 6	実施例 7	実施例 8	実施例 9
カチオン樹脂 1	75	75	55	55	55	35
カチオン樹脂 2	25	25	15	15	15	20
カチオン樹脂 3	—	—	—	—	—	15
カチオン樹脂 4	—	—	—	—	—	20
カチオン開始剤 1	2	—	2	2	2	—
カチオン開始剤 2	—	2	—	—	—	2
カチオン開始剤 3	—	—	—	—	—	—
ラジカル樹脂 1	—	—	20	20	20	5
ラジカル樹脂 2	—	—	—	—	—	5
ラジカル樹脂 3	—	—	10	10	10	—
ラジカル開始剤 1	—	—	0.5	0.5	0.5	—
ラジカル開始剤 2	—	—	—	—	—	0.5
レーザーの種類	Ar-1	Ar-1	Ar-1	Ar-2	Nd-YVO ₄	Ar-1
曲げ強度 (kg/cm ²)	700	720	810	800	760	790
アイゾット (kg・cm/cm ²)	6.4	6.9	6.5	6.2	6.1	6.4
造形精度 (縦横方向) (mm)	0.010	0.010	0.010	0.009	0.007	0.009
感度 (mJ/cm ²)	6.1	6.3	5.1	5.4	5.9	5.2
造形精度 (余剰硬化部) (mm)	0.12	0.11	0.13	0.10	0.11	0.12

【0143】

【表 3】

	実施例 10	実施例 11
カチオン樹脂 1	—	40
カチオン樹脂 5	100	50
カチオン開始剤 1	2	2
ラジカル樹脂 1	—	10
ラジカル開始剤 1	—	0.5
レーザーの種類	Nd - YVO ₄	Nd - YVO ₄
曲げ強度 (kg/cm ²)	700	880
アイゾット (kg・cm/cm ²)	7.1	6.8
造形精度 (縦横方向) (mm)	0.008	0.006
感度 (mJ/cm ²)	6.1	6.0
造形精度 (余剰硬化部) (mm)	0.11	0.10
引っ張り伸び (%)	8%	12%

【0144】

【表 4】

	比較例 1
カチオン樹脂 1	55
カチオン樹脂 2	15
カチオン開始剤 3	2
ラジカル樹脂 1	20
ラジカル樹脂 3	10
ラジカル開始剤 1	0.5
レーザーの種類	Ar - 1
曲げ強度 (kg/cm^2)	720
アイゾット ($\text{kg} \cdot \text{cm}/\text{cm}^2$)	6.1
造形精度 (縦横方向) (mm)	0.010
感度 (mJ/cm^2)	8.3
造形精度 (余剰硬化部) (mm)	0.15

【0145】

【発明の効果】

以上説明してきたように、本発明の芳香族スルホニウム塩化合物は効率のよい長波長部の光を吸収して活性化され、優れた光酸発生剤として作用する。また、これを含む光重合性組成物は迅速に硬化し、良質な硬化物物性を与え、よって、これを含む光重合性組成物のフォトリジストは高感度、高解像度を有する。また、本発明の芳香族スルホニウム塩化合物を含む光学的立体造形用樹脂組成物を用いることにより、従来技術の欠点を解消し、酸素による硬化阻害が起こらず、硬化時の精度がよく、余剰硬化部も小さく、容易に所望の寸法の造形物を得ることができ、しかも照射エネルギーに対して高感度で、硬化深度が十分であり層剥離のない、光学的立体造形方法を提供することができた。

【図面の簡単な説明】**【図 1】**

光学的立体造形システムにおいて、未硬化樹脂層を形成する工程を示す説明図である。

【図 2】

光学的立体造形システムにおいて、第 1 硬化層を得る工程を示す説明図である。

【図 3】

光学的立体造形システムにおいて、第 1 硬化層上にさらに未硬化樹脂を形成する工程を示す説明図である。

【図 4】

光学的立体造形システムにおいて、第 2 硬化層を得る工程を示す説明図である。

【図 5】

実施例における実験 3（造形精度試験）に用いた試験片の斜視図である。

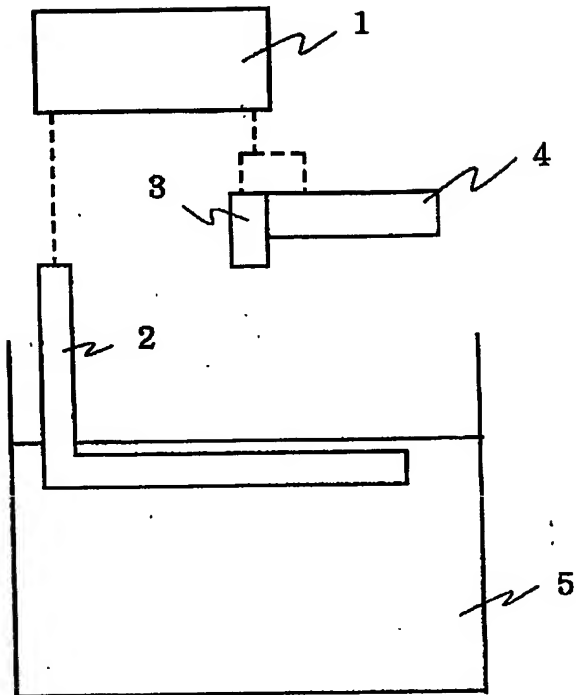
【符号の説明】

- 1 制御部
- 2 NC テーブル
- 3 光学系
- 4 レーザー
- 5 樹脂
- 6 レーザー光線
- 7 第 1 硬化層
- 8 第 2 硬化層

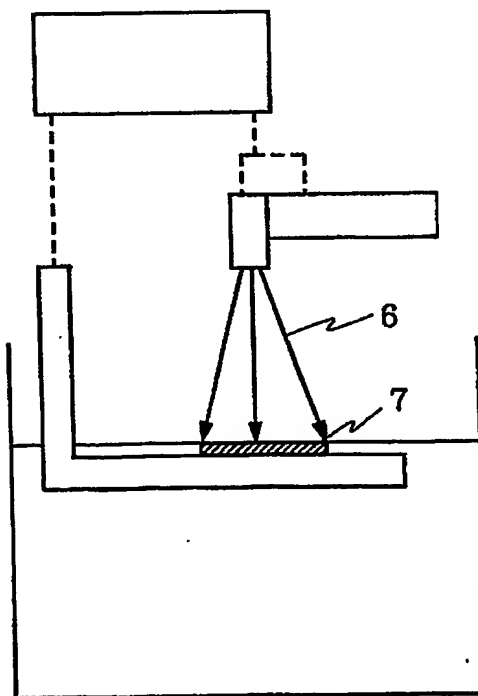
【書類名】

図面

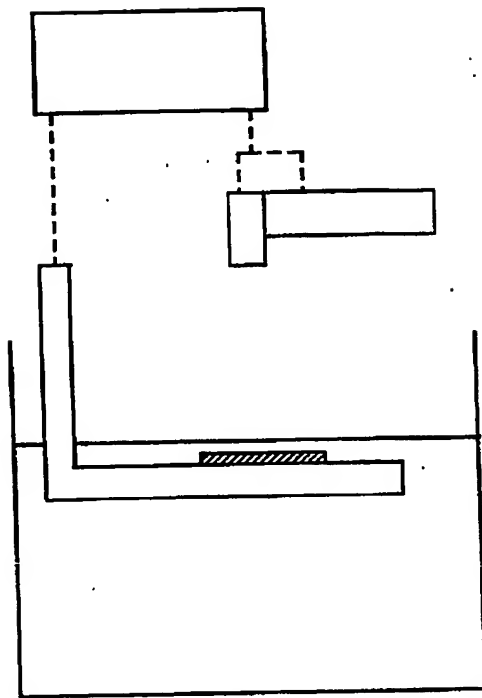
【図 1】



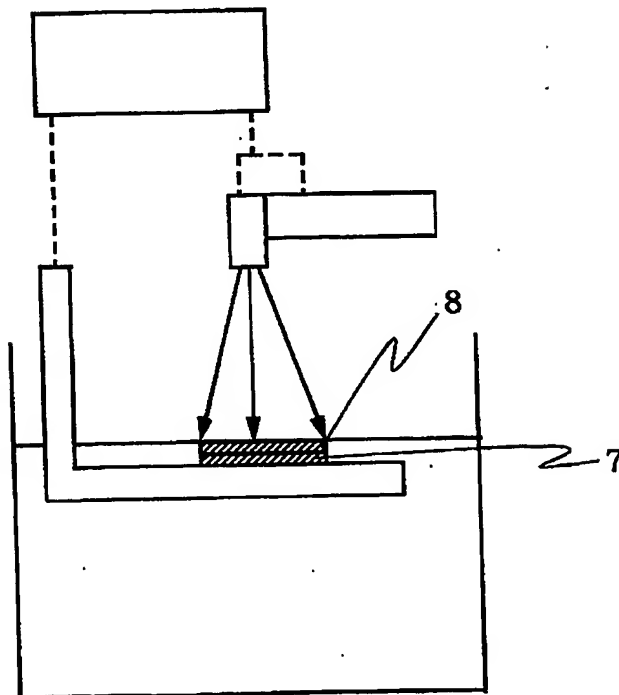
【図 2】



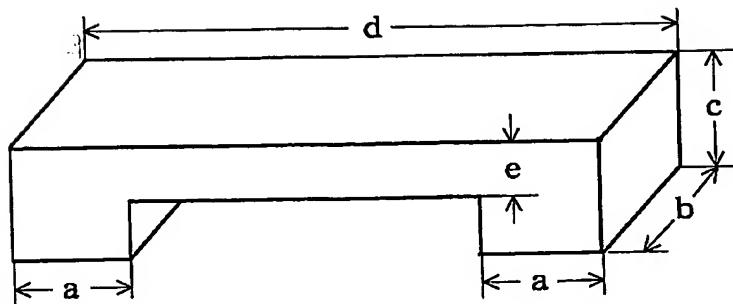
【図 3】



【図 4】



【図 5】

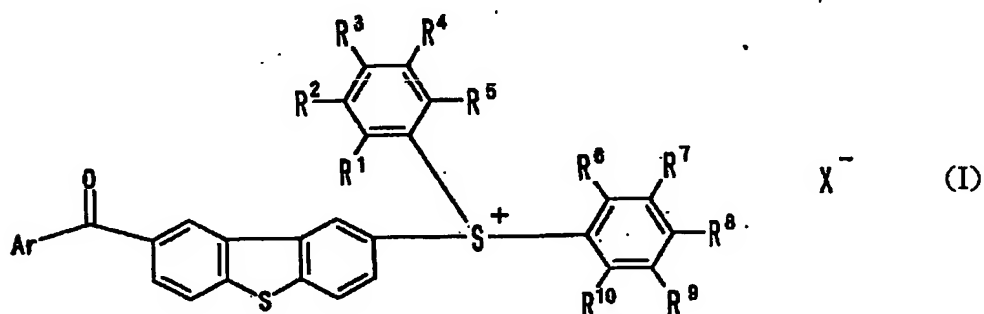


【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 光源からの光を効率的に吸収し、迅速で良質な硬化物を与える良好な光重合開始剤として有用な新規化合物、これからなる光酸発生剤およびこれを含む光重合性組成物を提供する。酸素による硬化阻害が起こらず、硬化時の精度が良く、容易に所望の寸法の造形物を得ることができ、しかも照射エネルギーに対して高感度で、硬化深度が十分である、光学的立体造形用樹脂組成物およびこれを用いた光学的立体造形方法を提供する。

【解決手段】 新規な芳香族スルホニウム塩化合物は、下記一般式（I）、



で表される。

【選択図】 なし

認定・付加情報

特許出願の番号	特願2003-085426
受付番号	50300493056
書類名	特許願
担当官	第六担当上席 0095
作成日	平成15年 3月27日

<認定情報・付加情報>

【提出日】

平成15年 3月26日

次頁無

特願 2003-085426

出願人履歴情報

識別番号

[000000387]

1. 変更年月日

1990年 8月15日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都荒川区東尾久7丁目2番35号

氏 名

旭電化工業株式会社